



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203155622 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201320147178. X

(22) 申请日 2013. 03. 28

(73) 专利权人 凌强

地址 226200 江苏省南通市启东市海复镇垦
牧村三组 12 号

(72) 发明人 凌强

(74) 专利代理机构 南京正联知识产权代理有限
公司 32243

代理人 胡定华

(51) Int. Cl.

B08B 3/12 (2006. 01)

B08B 3/10 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

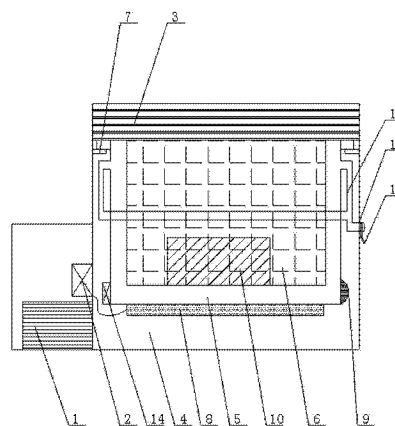
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

清洗装置

(57) 摘要

本实用新型公开了清洗装置,包括清洗部件和能量发生部分,其特征在于:所述能量发生部分包括电机和超声波发生装置,所述清洗部件包括上盖、清洗本体、清洗槽和待清洗工件置放处,所述清洗本体设于清洗槽外围,所述待清洗工件置放处设于清洗槽内,所述清洗本体内设有固定块,所述清洗槽活动设于固定块上,所述清洗槽底部设有超声波换能器,所述超声波换能器连接超声波发生装置,所述清洗槽上设有加热片,所述待清洗工件置放处为网格状,所述待清洗工件置放处上放置有待清洗工件,所述清洗本体的间隙小于待清洗工件的体积。本实用新型的优点是:设有加热设备,加上超声波清洗,使得效果达到最佳状态,整体结构简单,操作方便,便于推广。



1. 清洗装置,包括清洗部件和能量发生部分,其特征在于:所述能量发生部分包括电机和超声波发生装置,所述清洗部件包括上盖、清洗本体、清洗槽和待清洗工件置放处,所述清洗本体设于清洗槽外围,所述待清洗工件置放处设于清洗槽内,所述清洗本体内设有固定块,所述清洗槽活动设于固定块上,所述清洗槽底部设有超声波换能器,所述超声波换能器连接超声波发生装置,所述清洗槽上设有加热片,所述待清洗工件置放处为网格状,所述待清洗工件置放处上放置有待清洗工件,所述清洗本体的间隙小于待清洗工件的体积。

2. 根据权利要求1所述的清洗装置,其特征在于:所述清洗槽顶部周边设有溢流槽。

3. 根据权利要求2所述的清洗装置,其特征在于:所述溢流槽连接设于清洗本体上的溢流出口,所述溢流出口上设有阀门。

4. 根据权利要求1所述的清洗装置,其特征在于:所述清洗槽上设有过热保护装置。

5. 根据权利要求1所述的清洗装置,其特征在于:所述加热片为半导体加热片。

清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗设备领域,尤其涉及一种清洗装置。

背景技术

[0002] 随着制造技术的日益发展,各式各样的工件在机械加工过程中被使用,那么工件的清洗设备的使用也显得尤为的重要。现有技术中的工件清洗加工设备大多采用超声波清洗器,但是只有清洗池底部设置有超声波换能器,清洗效率不高,不能实现最佳的清洗效果。

[0003] 因此,急需一种改进的技术来解决现有技术中所存在的这一问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种清洗装置。

[0005] 本实用新型采用的技术方案是:

[0006] 清洗装置,包括清洗部件和能量发生部分,所述能量发生部分包括电机和超声波发生装置,所述清洗部件包括上盖、清洗本体、清洗槽和待清洗工件置放处,所述清洗本体设于清洗槽外围,所述待清洗工件置放处设于清洗槽内,所述清洗本体内设有固定块,所述清洗槽活动设于固定块上,所述清洗槽底部设有超声波换能器,所述超声波换能器连接超声波发生装置,所述清洗槽上设有加热片,所述待清洗工件置放处为网格状,所述待清洗工件置放处上放置有待清洗工件,所述清洗本体的间隙小于待清洗工件的体积。

[0007] 所述清洗槽顶部周边设有溢流槽。

[0008] 所述溢流槽连接设于清洗本体上的溢流出口,所述溢流出口上设有阀门。

[0009] 所述清洗槽上设有过热保护装置。

[0010] 所述加热片为半导体加热片。

[0011] 本实用新型的优点是:设有加热设备,加上超声波清洗,使得效果达到最佳状态,整体结构简单,操作方便,便于推广。

附图说明

[0012] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0014] 其中:1、电机,2、超声波发生装置,3、上盖,4、清洗本体,5、清洗槽,6、待清洗工件置放处,7、固定块,8、超声波换能器,9、加热片,10、待清洗工件,11、溢流槽,12、溢流出口,13、阀门,14、过热保护装置。

具体实施方式

[0015] 如图1所示,本实用新型的清洗装置,包括清洗部件和能量发生部分,所述能量发生部分包括电机1和超声波发生装置2,所述清洗部件包括上盖3、清洗本体4、清洗槽5和

待清洗工件置放处 6, 所述清洗本体 4 设于清洗槽 5 外围, 所述待清洗工件置放处 6 设于清洗槽 5 内, 所述清洗本体 4 内设有固定块 7, 所述清洗槽 5 活动设于固定块 7 上, 所述清洗槽 5 底部设有超声波换能器 8, 所述超声波换能器 8 连接超声波发生装置 2, 所述清洗槽 5 上设有加热片 9, 所述待清洗工件置放处 6 为网格状, 所述待清洗工件置放处 6 上放置有待清洗工件 10, 所述清洗本体 4 的间隙小于待清洗工件 10 的体积, 所述清洗槽 5 顶部周边设有溢流槽 11, 所述溢流槽 11 连接设于清洗本体 4 上的溢流出口 12, 所述溢流出口 12 上设有阀门 13, 所述清洗槽 5 上设有过热保护装置 14, 所述加热片 9 为半导体加热片, 设有加热设备, 加上超声波清洗, 使得效果达到最佳状态, 整体结构简单, 操作方便, 便于推广。

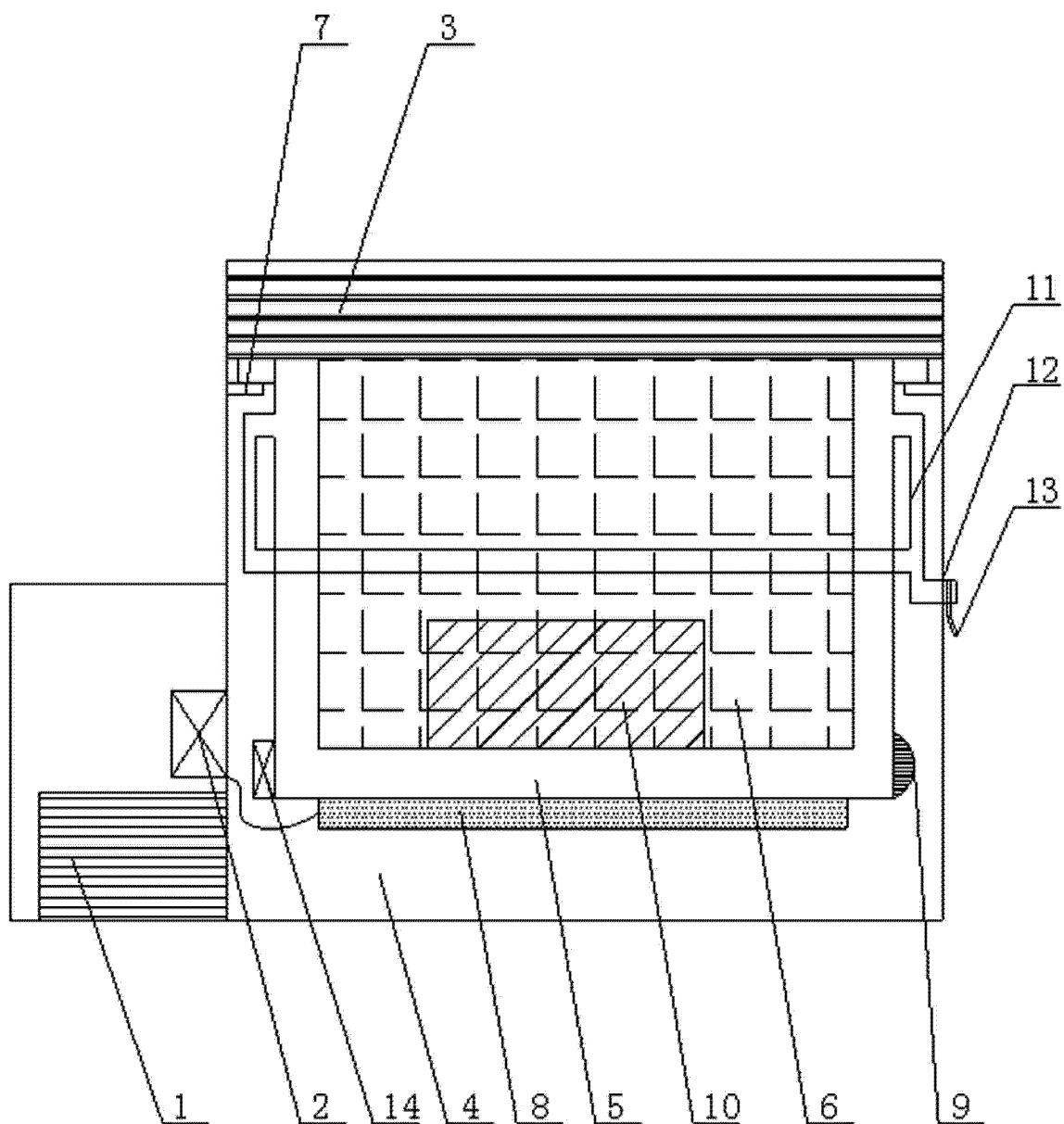


图 1